

06.3; 07

ВЛИЯНИЕ ОБЛАСТИ НАСЫЩАЮЩЕГОСЯ ПОГЛОТИТЕЛЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ $InGaAsP/InP$ РОС-ЛАЗЕРОВ С СИЛЬНОЙ КОРОТКОВОЛНОВОЙ РАССТРОЙКОЙ

В.И. Барышев, Е.Г. Голиков, А.Г. Дерягин, В.Г. Дураев,
Д.В. Куксенков, В.И. Кучинский,
В.Б. Смирницкий, Е.Л. Портной

Настоящая работа продолжает наши исследования [1–3] по изучению характеристик лазеров с распределенной обратной связью (РОС). Как показали проведенные исследования, РОС-лазеры, в которых линия брэгговской генерации расположена на коротковолновом склоне полосы усиления (с коротковолновой расстройкой), обладают рядом преимуществ. Среди них – значительное уменьшение радиочастотной ширины генерируемой линии [4], устойчивость одночастотного режима генерации при динамической накачке [2], расширенный температурный интервал существования одночастотной генерации [3]. Указанные преимущества РОС-лазеров с коротковолновой расстройкой проявляются тем сильнее, чем больше величина расстройки $\Delta\lambda = \lambda_{ROS} - \lambda_{max}$.

В лазерных диодах (ЛД) со сколотыми торцами увеличение расстройки свыше 150–200 Å затруднительно из-за возникновения генерации мод Фабри–Перо в максимуме полосы усиления. Дальнейший рост $\Delta\lambda$ возможен лишь с применением специальных мер, приводящих к эффективному изменению пороговых условий в пользу брэгговской генерации. Одной из таких мер является введение в конструкцию лазеров поглощающей области с контролируемыми параметрами, расположенной вблизи торца резонатора.

В настоящей работе изложены результаты экспериментального исследования влияния поглощающей области, расположенной вблизи торца резонатора, на характеристики $InGaAsP/InP$ ($\lambda = 1.5$ – 1.6 мкм) РОС-лазеров с сильной коротковолновой расстройкой $\Delta\lambda$.

Мезополосковые гетеролазеры с РОС изготавливались на основе двух однотипных гетероструктур, изготовленных по методике [5] и отличающихся друг от друга только глубиной профиля дифракционной решетки и величиной коэффициента обратной связи K . При длине лазерных диодов $L \sim 250$ мкм величина $K \times L$ для лазеров, изготовленных из одной гетероструктуры, составляла ~ 2.5 и ~ 1 из другой. Период решетки Λ выбирался таким образом, чтобы обеспечить получение брэгговской генерации на длине волны $\lambda_{ROS} \approx 1.52$ мкм, что при длине волны максимума люминесценции активного слоя гетероструктур $\lambda_{max} = 1.57$ мкм соответствует расстройке $\Delta\lambda = -500$ Å.

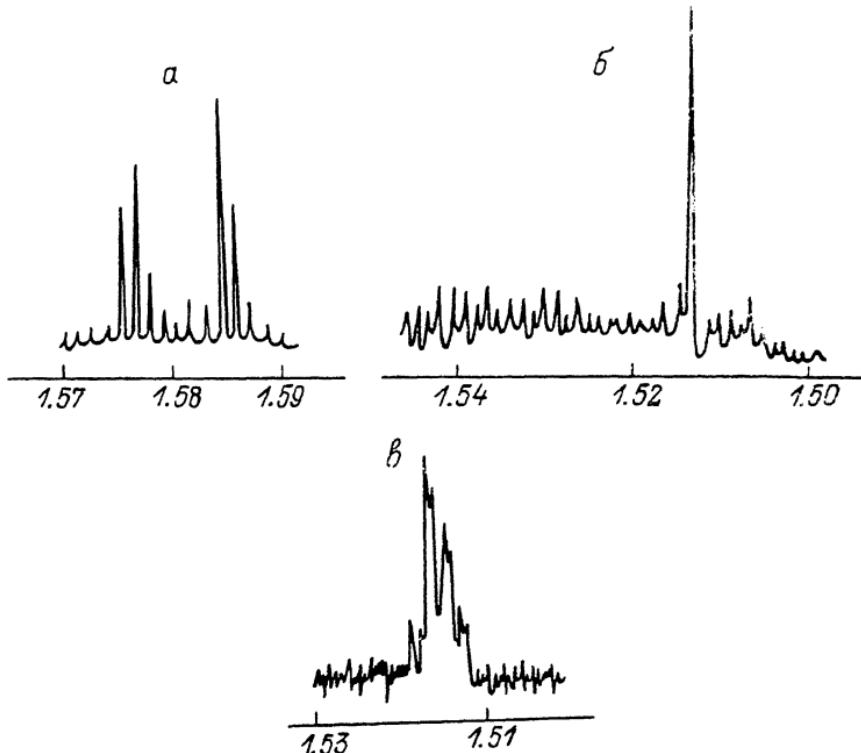


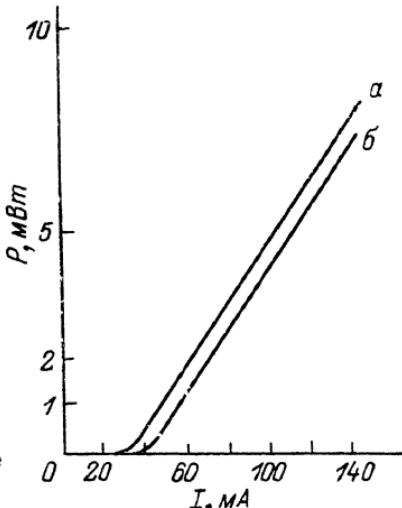
Рис. 1. Спектры излучения: а - необлученного образца в непрерывном режиме вблизи порога генерации, б - облученного дозой $5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ образца с $KL \sim 2.5$ в непрерывном режиме вблизи порога генерации, в - облученного образца с $KL \sim 1$ в пичковом режиме генерации.

Поглощающая область вблизи торца резонатора исследуемых лазеров создавалась с помощью глубокой имплантации тяжелых ионов. Для имплантации использовались ионы N^{3+} с энергией 10 МэВ. Доза имплантации накапливалась постепенно, и на каждом этапе контролировались пороговые, спектральные и мощностные характеристики излучения лазерных диодов со стороны необлученного торца. Проводился также контроль наличия или отсутствия пичкового режима генерации.

Рассмотрим данные экспериментальных исследований для образцов ЛД с сильной связью ($KL \sim 2.5$). На рис. 1, а представлен типичный спектр излучения необлученного образца в непрерывном режиме вблизи порога генерации. Как видно, в спектре наблюдается характерный для Фабри-Перо резонатора набор продольных мод с максимумом интенсивности на длине волны $\lambda_{\max} = 1.575 \text{ мкм}$. Ватт-амперная характеристика необлученного образца представлена на рис. 2, а.

После образования в результате имплантации поглощающей области вблизи торца резонатора в спектре излучения на коротковолновом краю появляется брегговская мода, интенсивность которой

Рис. 2. Ватт-амперные характеристики: а - необлученного образца в непрерывном режиме генерации, б - облученного дозой $5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ образца с $KL \sim 2.5$ в непрерывном режиме генерации.



по сравнению с продольными модами резонатора Фабри-Перо увеличивается с ростом дозы облучения. При дозе $5 \cdot 10^{11} \text{ ион}/\text{см}^2$ порог брэгговской генерации оказывается ниже порога генерации Фабри-Перо,

и спектр излучения лазера в непрерывном режиме генерации становится одночастотным. При этом пороговый ток образца возрастал в среднем на 50 %, а дифференциальная квантовая эффективность оказывалась практически неизменной. При дальнейшем увеличении дозы имплантации пороговый ток и эффективность не изменялись. Относительная же доля в спектре излучения шума, обусловленного присутствием мод Фабри-Перо, продолжала уменьшаться. Спектр генерации в непрерывном режиме вблизи порога и ватт-амперная характеристика для дозы облучения $5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ приведены на рис. 1, б и 2, б соответственно.

Контроль динамического режима генерации исследованных лазеров осуществлялся при накачке образцов импульсами тока с длительностью 10 нс при длительности фронта 0.5 нс. Осциллограмма импульса выходного излучения регистрировалась с помощью *InGaAsP p-i-n* фотодиода и стробоскопического осциллографа С1-91/4. Суммарная разрешающая способность установки по времени составляла 80 пс. Измерения продемонстрировали отсутствие осцилляций в выходном импульсе излучения. Пятикратное превышение тока накачки над пороговым значением не приводило к срыву одночастотного режима брэгговской генерации.

Таким образом, в образцах ЛД с сильной связью поглощающая область, образованная имплантацией ионов и расположенная у торца резонатора, эффективно подавляет обратную связь для мод Фабри-Перо. В отличие от работы [6], где для подавления генерации мод Фабри-Перо использовалась пассивная область длиной в сотни мкм, в нашем случае длина поглощающей области $l_{\text{пог}} = 10 \text{ мкм} \ll \frac{1}{K}$, что не приводит к существенному снижению эффективности распределенной обратной связи. Следствием этого оказывается установление одночастотного режима брэгговской генерации с сильной коротковолновой расстройкой и отсутствие осцилляций в выходном излучении лазера. Отметим также отсутствие гистерезиса в ВАХ исследованных образцов.

Перейдем теперь к анализу экспериментальных данных для ЛД со слабой обратной связью ($KL \leq 1$). Как и в случае ЛД с силь-

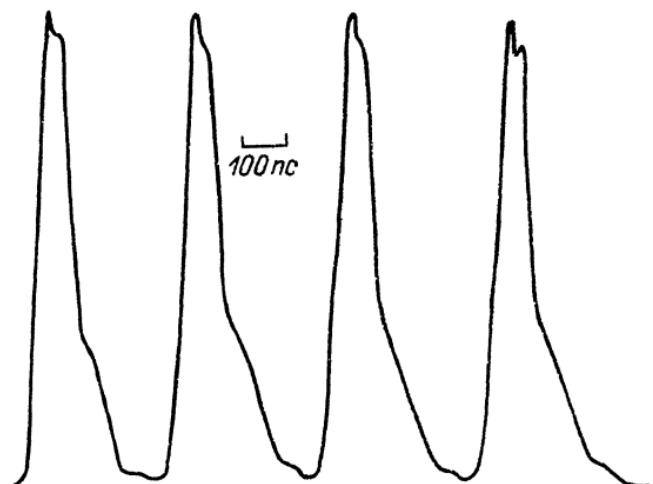


Рис. 3. Осциллограмма выходного излучения облученного образца с $KL \sim 1$ в пичковом режиме генерации.

ной связью, введение поглощающей области вызывает эффективное изменение пороговых условий в пользу брэгговской генерации. Одновременно происходит значительное повышение порогового тока и снижение д.к.э., вызываемое сокращением длины формирования обратной связи на 10 %. В среднем повышение порогового тока в 2.5–3 раза происходило при достижении дозы имплантации $2 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$. Контроль динамического режима генерации показал наличие пичкового режима в определенном диапазоне амплитуд тока накачки. Типичная осциллограмма выходного излучения приведена на рис. 3. С учетом разрешения установки длительность отдельного пичка в исследованных образцах может быть оценена в 60 пс. Следует отметить, что длительность пичка зависела от амплитуды тока накачки и изменялась в пределах от 100 до 60 пс.

Спектр генерации при работе лазера в пичковом режиме (рис. 1, в) включает в себя помимо двух основных брэгговских частот две „субмоды“. Общая полуширина огибающей спектра составляет $\sim 25 \text{ \AA}$ и занимает, таким образом, промежуточное положение между шириной спектра для РОС и Фабри-Перо генерации в режиме модуляции добротности. Появление в спектре дополнительных субмод обусловлено недостаточной эффективностью РОС и значительным превышением накачки над пороговым значением в момент просветления области НП.

Таким образом, основные выводы настоящей работы заключаются в следующем.

1. Наличие поглощающей области, образованной имплантацией ионов, вблизи торца резонатора лазерного диода с РОС позволяет эффективно подавить генерацию мод Фабри-Перо.

2. В РОС-лазере с высоким значением KL наличие такой области позволяет получить устойчивую одночастотную генерацию с сильной коротковолновой расстройкой.

3. В РОС-лазере с $KL \leq 1$ поглощающая область приводит к получению брэгговской генерации в пичковом режиме с длительностью пичка 60–100 пс.

Авторы благодарят Ж.И. Алфёрова за поддержку работ по РОС-лазерам и Г.М. Гусинского за проведение глубокой имплантации на циклотроне ФТИ.

Список литературы

- [1] А л ф ё р о в Ж.И., К и ж а е в К.Ю., К у ч и н с к и й В.И., К у к с е н к о в Д.В., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 9. С. 513-517.
- [2] К и ж а е в К.Ю., К у к с е н к о в Д.В., К у ч и н с к и й В.И., Н и к и т и н С.А., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 3. С. 267-273.
- [3] Г у р и е в А.И., К у к с е н к о в Д.В., К у ч и н с к и й В.И., Н и к и т и н С.А., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 12. С. 1082-1088.
- [4] O g i t a S., Y a n o M., I s h i k a w a H., I w a i H. // Electr. Lett. 1987. V. 23. N 8. P. 393-394.
- [5] Б а р ы ш е в В.И., Г о л и к о в а Е.Г., Д у р а е в В.П., К у ч и н с к и й В.И., К и ж а е в К.Ю., К у к с е н к о в Д.В., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Квантовая электроника. 1988. Т. 15. № 11. С. 2196-2198.
- [6] S a k a i K., U t a k a K., A k i b a S., M a t s u s h i m a Y. // IEEE J. of Quant. Electr. 1982. V. QE-18. N 8. P. 1272-1278.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
5 июля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 17
05.3; 10· 11

12 сентября 1989 г.

НЕТЕПЛОВЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ЭФФЕКТЫ
ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ СПЛАВОВ
УСКОРЕННЫМИ ИОНАМИ

С.Н. Б о р о д и н, Ю.Е. К р е й и д е л ь,
Г.А. М е с я ц, В.В. О в ч и н и к о в,
В.А. Ш а б а ш о в

Известно [1, 2], что ионная бомбардировка приводит к изменению физических свойств приповерхностных слоев металлических сплавов. При этом глубина модифицированной зоны во многих случаях существенно превышает пробеги бомбардирующих частиц. Передача энергии ионного воздействия в модифицируемом слое при типичных для